



ArF 液浸スキャナー

NSR-S636E

Proven Solutions Through Evolution



重ね合わせ精度とスループットを高レベルで両立した

クリティカルレイヤー向けArF液浸スキャナー

ArF液浸スキャナーNSR-S636E

NSR-S636Eは、従来機から搭載している高機能アライメントステーション「inline Alignment Station (iAS)」をさらに改良。高いスループットを維持しつつ、ウェハの反りや歪みをより高精度に計測・補正することを可能にしました。

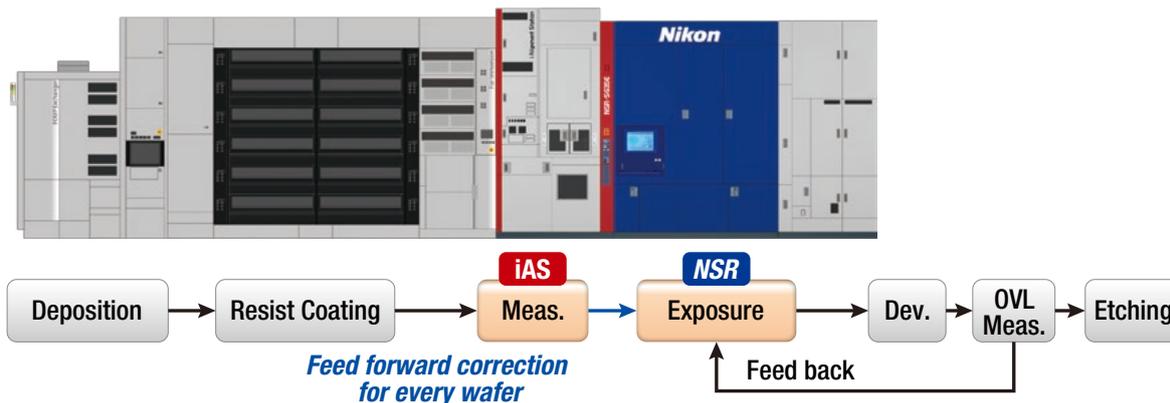
さらにダウンタイムの低減などにより、総合的な生産性を改善。ニコンの半導体露光装置の中で最高水準の生産性を実現しました。

Performance

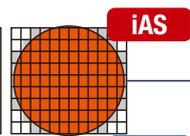
解像度	≤ 38 nm
NA	1.35
露光光源	ArF excimer laser (193 nm wavelength)
縮小倍率	1:4
最大露光範囲	26 mm × 33 mm
重ね合わせ精度	≤ 2.1 nm (MMO* ¹)
スループット	≥ 280 wafers/hour (96 shots)

*1 Mix and Match Overlay: 同一機種間の重ね合わせ精度 (例 NSR-S636E#1 to S636E#2)

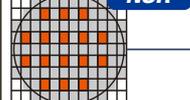
高機能アライメントステーション「inline Alignment Station (iAS)」の特長



Measure and FF
- Dense sampling
- High order grid correction



Alignment on the NSR
- Sparse sampling
- Linear grid correction



+

Alignment Corrections

アライメントステーションとは、露光装置のスループットを落とすことなく高速・高精度にウェハを計測し、グリッドエラーの補正を可能にするシステムです。これをインラインで露光装置内に組み込んだものがiASになります。iASにより、スループットを低下させることなく、全ショットでの多点アライメントが可能になり、飛躍的な精度向上を実現しました。

クラス1レーザ製品



安全に関するご注意

■ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご 注 意

本製品および製品の技術(ソフトウェアを含む)は「外国為替および外国貿易法」に定める規制貨物等(特定技術を含む)に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。

●このカタログは2024年7月現在のものです。仕様と製品は、製造者側がなんら債務を被ることなく予告なしに変更されます。

●このカタログに掲載の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

©2024 NIKON CORPORATION

株式会社 **ニコン**

精機事業本部 商品戦略部 140-8601 東京都品川区西大井1-5-20 電話(03)6743-5533

株式会社ニコンテック 140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル 電話(03)5762-8911

<https://semi.nikon.com/>